PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-139222

(43) Date of publication of application: 13.05.1992

(51)Int.CI.

CO8J 5/00 CO8G 69/44 // CO8L 77:00

(21)Application number: 02-263629

(71)Applicant: MITSUBISHI KASEI CORP

(22)Date of filing:

01.10.1990

(72)Inventor: ODA FUMIHIKO

(54) PRODUCTION OF HIGH POLYMER MOLDED ARTICLE

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain the highly oriented title molded article being excellent in mechanical characteristics such as modulus by applying a magnetic field to a thermally transferable liquid crystalline high polymer which is a wholly aromatic polyesteramide in a liquid crystal state. CONSTITUTION: A magnetic field is applied to a thermally transferable liquid crystalline high polymer which is a wholly aromatic polyesteramide synthesized from a combination of two or more kinds of compound respectively selected from aromatic diamine, aromatic dicarboxylic acid and aromatic diol compound and from aromatic aminocarboxylic acid, aromatic oxycarboxylic acid and aromatic oxyamino compound, etc., in a liquid crystal state to provide the objective molded article.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C): 1998,2003 Japan Patent Office

的日本国特許庁(JP)

卯特許出願公開

母公開特許公報(A) 平4-139222

Mint. Cl. 1 C 08 J C 08 G 5/00 69/44 77:00 識別記号 庁内整理番号 母公開 平成4年(1992)5月13日

8517-4F 9053-4J

CFG NSR

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称 高分子成形体の製造方法

纽特 顧 平2-263629

■ 平2(1990)10月1日

B 蚏

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱化成株式会社

经合研究所内

る出 斑 三菱化成株式会社 東京都千代田区丸の内 2丁目 5番 2号

弁理士 長谷川 の代理 人

外1名

1 発明の名称

高分子成形体の製造方法

2 特許請求の範囲

(1) 熱液晶性高分子に液晶状態で磁場を印加し で高分子成務体を製造する方法において、熱度品 性事分子が全労者施ポリエステルアもドであるこ とを特徴とする高分子成形体の製造方法。

3 発明の評価な説明

(倉景上の利用分野)

本発明は高分子成形体の製造方法に関する。評 しくは、磁場を用いて高分子収渉体を製造する方 住に関する。

(従来の技術とその課題)

ポリマー皮形体の弾性率は分子根の配向に依存 する。高分子の分子額の配筒を達成する手段とし ては各種の延伸、液晶的糸等が開発されて自た。 しかし、これらの技術によって成形される製品は、 フィルムやファイバー等に限られていた。

一方、磁場を被晶性高分子に作用させる方法が

任意の形状を有する皮形体における分子配向手段 として注目される。しかしながら磁塔による配向 のエネルギーは比較的小さいことから、液晶性高 分子を配向させることには解決すべき問題が多い。 (課題を解決するための手段)

高弾性率と磁場配向性の両方を満たすポリマー の化学構造について検討を行った結果、本発明に

声ち、本発明は、熱液晶性高分子に液晶状態で 遺場を印加して高分子成形体を製造する方法にお いて、熟液晶性高分子が全方書族ポリエステルア えドであることを特徴とする高分子成形体の製造 方法である。

以下、本発明を詳述べる。

熱液晶性高分子は加熱溶融時に液晶を形成する 高分子であり、各種の高分子が知られている。戦 場の作用によって高分子銀を高度に配削させるに は、磁場による配向エネルギーが小さいため比較 的分子量の低いあるいは低粘度のポリマーが好ま しい。一方、咸彦体の力学特性については、一般

特略平 4~139222 (2)

に分子量の高い方が好ましい。この矛盾する2つの要求を満すにはポリマーの化学構造が重要である。本発明では熱液晶性高分子として全芳香族ポリエステルアミドを用いる。

全芳香族ボリエステルアミド自体は公知であり、 芳香族環局志をエステル結合とアミド結合で連結 した主領構造を有する熱液晶性高分子であり、好 ましくは主線がエステル結合で構成され50モル %以下のアミド結合を有するものがあげられる。

全芳香族ポリエステルアミドとして好ましいものとしては、以下に示す芳香族ジアミン、芳香族ジカルポン酸、芳香族ジオール化合物、あるいは芳香族アミノカルボン酸、芳香族オキシカルボン酸、芳香族オキシアミノ化合物あるいはこれらの論性快導体、これらの核置換化合物から選ばれる2種以上の組合せから合成される全芳香族ポリエステルアミドである。

3、3'ージメチルー4、4'ージアミノビフェニル、3、3'ージクロルー4、4'ージアミノビフェニル、2、2'ージクロルー4、4'ージアミノビフェニル、2、2'ージメチルー4、4'ージアミノビフェニル、2、6ーナフタレンジアミン、4、4'ージアミノジフェニルスルフェン、4、4'ージアミノジフェニルン、ピス(4ーアミノフェニル)ブタン、3、3'ージアミノベンゾフェノン等が挙げられ、このうち好ましいものは1、4ーフェニレンジアミン、クロルー1、4ーフェニレンジアミン、3、3'ージメチルー4、4'ージアミノビフェニル、2、6ーナフタレンジアミンである。

芳香瓶ジカルボン酸の好ましい具体例はテレフタル酸、イソフタル酸、ピスー 4 ーカルボキシルフェニルー1. 4 ーベンゼン、4. 4' ーカルボキシルジフェニル、ナフタリンー2. 6 ージカルボン酸、ナフタリンー1. 5 ージカルボン酸、ナ

ここで、A. A': - O H. - C O O H. - N H。およびこれらの機能性誘導体

また芳香環はアルキル基、アルコキシ基、フェニル基、フェノキシ基、ハロゲン基で覆換されていても良い。

芳香族ジアミンの具体例としては、1, 4-フェニレンジアミン、メチルー1, 4-フェニレンジアミン、クロルー1, 4-フェニレンジアミン、

フェニルケトンー4、 4' ージカルボン酸、メチルテレフタル酸、クロロテレフタル酸、フェニルテレフタル酸、 2、 5 ージメチルテレフタル酸、 ジフェニルー3、 3' ージメチルー4、 4' ージ カルボン酸である。

芳香族ジオールの好ましい具体例は、クロルハイドロキノン、メチルハイドロキノン、2.6-ジヒドロキシナフタレン、1.4-ジヒドロキシナフタレン、4.4'-ジヒドロキシピフェニル、3.3'-ジメチルー4.4'-ジヒドロキシジフェニル、アセトキシハイドロキノン、ニトロハイドロキノン、ジメチルアミノハイドロキノン、1.5-ジヒドロキシナフトール、1.6-ジヒドロキシナフトール、ビス(4-ヒドロキシフェニル)~1.4-ベンゼンである。

芳香族アミノカルボン酸の好ましい具体例は、 pーアミノ安息香酸、mーアミノ安息香酸、6~ アミノー2ーナフトエ酸、4ーアミノー1~ナフトエ酸、pーアミノー0~メトキシ安息香酸、p ーアミノー0~クロロ安息香酸等である。

特局平 4-139222(含)

労者族オキシカルボン酸の好ましい具体例は、 2 ーヒドロキシー6 ーカルボキシルナフタレンー pーヒドロキシ安息者酸、mーヒドロキシ安息者 酸、4 ーヒドロキシピフェニルカルボン酸、4 ー ヒドロキシー4'ーカルボキシジフェニルエーテ ル、2 ークロローpーヒドロキシ安息者酸等である。

芳書版オキシアミノ化合物の好ましい具体例は pーアミノフェニル、4ーアミノー4'ーヒドロ キシージフェニル、4ーアミノー1ーナフトール、 3ーメチルー4ーアミノフェニル、Nーメチルー 4ーアミノフェノール、3ーアミノフェノール、 3ーメチルー4ーヒドロキシー4'ーアミノージ フェニルである。

重合は公知の方法に従い、アセチル化されたアミノ番および水酸落とカルボン酸番の反応を加熱 溶融状態で行う方法により全芳香族ポリエステルアミドが得られる。

全労者液ポリエステルアミドが磁場配向に適す る理由は明らかではないが、異種結合による結晶

本発明は、上述の液晶性全芳香族ポリエステル アミドを格融し、例えば押出あるいは射出成形に で成形体を製造する際、あるいは成形後再加熱し で液晶を形成している状態で磁場を印加する。

磁場を作用させる方法としては、全芳香族ポリ エステルアミドを加熱し、ネマチック被晶状態の 溶動物を磁場中に必要な時間保持すればよい。こ

本発明で製造する成形体としては例えば抽線、 フィルム、概および種々の形状を持つ 3 次元的成 形品等が挙げられる。

[實施例]

以下、本発明を実施例により辞述するが本発明 はその要替を超えない限り、実施例に限定される ものではない。

実施例1および比較例1

2ーアセトキシー6ーカルボキシナフタレン (0.4 モル)、テレフタル酸 (0.1 モル)、 pーアミノフェノール (0.1 モル) から溶動堂合により無液晶性ポリエステルアミドを合成した。このポリマーの動的博融粘度をコーンプレート型粘度計を用いて310で、2×10-18:で例定したところ10*ポイズであった。

このポリマーに330℃で20分間、100キロガウスの磁場を作用させて直径1mのロッドを成形した。このロッドは54GPa (室温、110Hzスパン15mで規定)の非常に高い動的曲げ現性率を示した。

比較のため上記のポリマー組成においてァーア ミノフェノールの代りにクロルハイドロキノンを 使用したポリマーを関様に合成した。

このポリマーの溶動物度を前記と関係にして測定したところ、800ポイズであった。また、前記と同一の方法、条件により成形した直径1mのロッドの弾性率は35GPaと本発明の方法に比べて小さいものであった。

持期平 4-139222 (4)

(発明の効果)

本発明方法によれば、高配向した神性率等の機 被特性に優れた高分子成形体を得ることができる。

出 曜 人 三菱化 成株式会社 代 環 人 弁理士 長等川 ー (ほか1名)